

VBL プロセス利用者(初めての人)向け 半導体プロセス講習会のご案内

ベンチャービジネスラボラトリー1Fの機能集積化デバイスプロセス室は半導体プロセス用のクリーンルーム(固体機能デバイス施設とクリーンルームで直結)でありSiのCMOSプロセスを基礎としているため、本プロセス室および設置されている機器の利用には半導体プロセス講習会によるライセンス取得が使用の条件となります。このための講習会を下記のように開催します。本年度より初めてVBLプロセス室の利用希望者は受講してください。

記

1. 開催日時・場所

日時:下記のうちいずれか一回を受講してください

第一回 平成 16 年 5 月 17 日(月) 13:30 ~ 15:00

第二回 平成 16 年 5 月 18 日(火) 13:30 ~ 15:00

場所:ベンチャービジネスラボラトリー3F プロジェクト研究交流室

2. 講習会の内容

*クリーンルーム使用の諸注意

*ガス、薬品等の安全利用に関する説明

(座学による説明後、実際にクリーンルームに入室して頂きます)

3. 事前配布資料

VBL ホームページよりダウンロードして持参ください

* ベンチャービジネスラボラトリー利用の手引き

* クリーンルーム使用にあたる注意事項

* 安全の手引き

4. 申込先

VBL 助手 野田

E-Mail: noda@vbl.tut.ac.jp, 内線 6974

希望日を明記の上、ご連絡下さい

申込〆切 5月13日(木)

受講者へ

・講習会を受講しますと専用の入退室管理用のカードキーを発行します。(教職員のみ)

・クリーンルーム設置機器の取扱説明は後日行います。